

AS-MASTER

Máquina RTP/RTCVD 200mm polivalente
Ambiente a 1500°C, ATM a 10⁻⁷ Torr
Cargamento manual o automático

APLICACIONES

- Recocido rápido (RTA, RTO)
- Recocido de contacto SiC, Carburación
- Recocido de semiconductores compuestos
- Control de implantación
- RTCVD (poli silicio, SiO₂, SiN_x,...)

ESPECIFICACIONES

El horno de recocido rápido es una máquina muy polivalente que permite realizar un gran número de procesos, desde el recocido rápido hasta el depósito químico en fase vapor. La versión alta temperatura permite el desarrollo de nuevos procesos hasta 1500°C.

Una cámara cuadrada está disponible en opción para el tratamiento de grandes substratos cuadrados o rectangulares.

La tecnología de paredes frías procura una excelente reproducibilidad de los procesos en un medio ambiente ultra limpio y sin contaminación.

Una antecámara loadlock y una versión para cargamento bajo vacío están disponibles en opción para condiciones de limpieza más severas.

La amplitud del rango de temperatura y de presión con posibilidad de mezclar los gases autorizan el uso de la máquina AS-Master para una amplia gama de procesos RTP y RTCVD.

La medida de temperatura por termopar y pirómetro asociada con el controlador de temperatura PID numérico rápido ofrece un control óptimo de la temperatura.

Disponible con un cargamento manual o casete a casete, la máquina permite un pasaje fácil de la investigación a la producción.

CARACTERÍSTICAS

- Rango de temperatura del ambiente a 1500°C
- Rampa de temperatura hasta 200°C/s
- Posibilidad de mezclar los gases
- Rango de presión del atmósfera hasta 10⁻⁷ Torr



www.annealsys.com

RTP/RTCVD

AS-MASTER

Versión AS-Master	S20	S20 HT	2000
Temperatura máxima	1150°C	1500°C	1250°C
Zonas de calentamiento independientes	6	6	10
Potencia máxima	75 kW	105 kW	90 kW

Características generales

Talla máxima de los substratos	Diámetro 200 mm 200 mm x 200 mm para la versión cámara cuadrada
Cámara de proceso	Acero inoxidable enfriada por agua y con ventanilla de cuarzo Volumen reducido de la cámara de proceso Cámara cuadrada en opción
Calentamiento	Horno multi zonas con lámparas infrarrojas Enfriamiento de lámparas con ventiladores y intercambio Versión alta temperatura hasta 1500°C
Rango de temperatura	Control por termopar Control por pirómetro óptico (4 posiciones) Control de temperatura PID numérico rápido
Vacío y gas	Línea de purga con válvula de aguja Hasta 6 líneas de gas con controlador de débito de flujo Válvula de vacío y sensor de vacío Opción bomba a paleta o bomba de espiral Opción bomba turbo molecular Opción control de presión con válvula mariposa
Control	Control completo por PC, hasta 100 etapas por receta Comunicación Ethernet con el horno para adquisiciones rápidas Trazabilidad de los procesos
Alimentaciones	Tensión : 3x400V+N+Gr o 3x220V+Gr con transformador Potencia : según versión, ver en lo alto de la página Agua: 2 a 6 bars, pérdida de carga 1 bar, 25 a 50 l/mn Aire comprimido : 6 bars (control de las válvulas) Racores de gas : VCR ¼ o Swagelok ¼
Dimensiones y peso	Anchura : 1104 mm Altura : 2500 mm Profundidad: 1550 mm Peso : 850 kg

www.annealsys.com

ANNEALSYS

Bat T2, PIT de la Pompignane
Rue de la Vieille Poste
F-34055 Montpellier Cedex 1
Tel: +33 467 20 23 63
Fax: +33 467 20 26 89
Email: info@annealsys.com